

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 10 月 23 日 (23.10.2003)

PCT

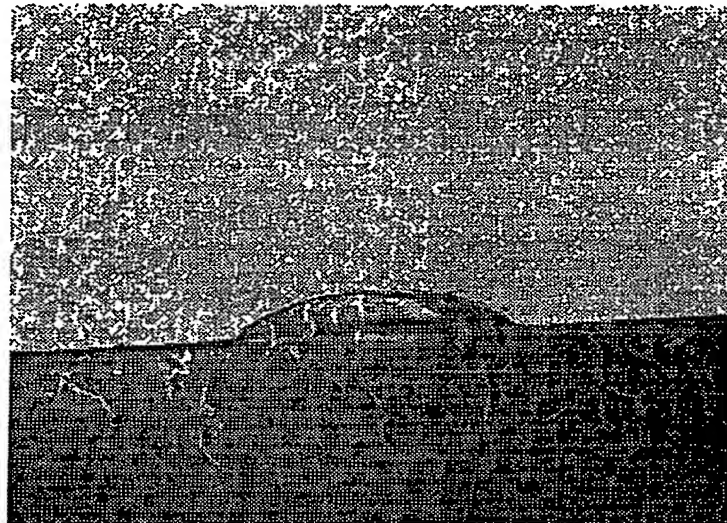
(10) 国際公開番号
WO 03/087941 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G03F 7/039, 7/022, 7/40 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP03/04954 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 畑中 真
(22) 国際出願日: 2003 年 4 月 18 日 (18.04.2003) (HATANAKA, Tadashi) [JP/JP]; 〒274-8507 千葉県
(25) 国際出願の言語: 日本語 船橋市 坪井町 7 2 2 番地 1 日産化学工業株式
(26) 国際公開の言語: 日本語 会社 電子材料研究所内 Chiba (JP). 仁平 貴康 (NI-
(30) 優先権データ: 特願2002-115566 2002 年 4 月 18 日 (18.04.2002) JP HIRA, Takayasu) [JP/JP]; 〒274-8507 千葉県 船橋市
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日産化学 坪井町 7 2 2 番地 1 日産化学工業株式会社 電子材
工業株式会社 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒101-0054 東京都 千代田区 神田錦町 料研究所内 Chiba (JP).
3 丁目 7 番地 1 Tokyo (JP). (74) 代理人: 泉名 謙治, 外 (SENMYO, Kenji et al.); 〒
(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, 101-0042 東京都 千代田区 神田東松下町 3 8 番地 烏
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, 本鋼業ビル Tokyo (JP).
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: POSITIVELY PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND METHOD OF PATTERN FORMATION

(54) 発明の名称: ポジ型感光性樹脂組成物およびパターン形成方法



(57) Abstract: A positively photosensitive resin composition which can be developed with an aqueous tetramethylammonium hydroxide solution having an ordinary concentration, has high sensitivity and excellent resolution, and is excellent in heat resistance, surface smoothness, transparency, etc. and reduced in water absorption; and a method of forming from the composition a pattern having any desired section such as a semicircle or trapezoid. The positively photosensitive resin composition comprises an alkali-soluble resin, a 1,2-quinonediazide compound, a crosslinking compound having two or more epoxy groups, and a surfactant, the alkali-soluble resin being a copolymer comprising essential units derived from a carboxylated acrylic monomer, a hydroxylated acrylic monomer, and an N-substituted maleimide. By changing conditions for the post-baking of this composition, a pattern shape having any desired section such as a semicircle or trapezoid is obtained.

(57) 要約: 一般的な濃度の水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液で現像でき、感度が高く、解像度に優れ、かつ耐熱性、平坦化性、透明性、低吸水性等に優れるポジ型感光性樹脂組成物を提供する。更

[続葉有]

BEST AVAILABLE COPY

WO 03/087941 A1



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

に、該組成物を使用し、半円形または台形等の任意の断面を持つパターン形成できるパターン形成方法を提供する。本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、アルカリ可溶性樹脂と、1, 2-キノンジアジド化合物と、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物と、界面活性剤とを含有し、上記アルカリ可溶性樹脂は、カルボキシル基含有アクリルモノマーと水酸基含有アクリルモノマーとN-置換マレイミドとを必須成分とする共重合体にある。この組成物のポストバーク条件を変えることにより、半円形又は台形等の任意の断面を持つパターン形状が得られる。

明細書

ポジ型感光性樹脂組成物およびパターン形成方法

技術分野

本発明はポジ型感光性樹脂組成物に関する。さらに詳しくは液晶表示素子（LCD）に用いられる薄膜トランジスタ（TFT）の層間絶縁膜、カラーフィルターの保護膜および平坦化膜、反射型ディスプレイの反射板として用いられるAl膜下の凹凸膜、マイクロレンズ材料、有機EL素子の絶縁膜等を形成する材料として好適なポジ型感光性樹脂組成物およびそのパターンの形成方法に関する。

背景技術

一般に、液晶表示素子、有機EL素子等のディスプレイ材料においては電極保護膜、平坦化膜、絶縁膜等が設けられている。これらの材料にはアクリル樹脂、ノボラック樹脂、ポリイミド樹脂などが用いられている。これらの保護膜、平坦化膜、絶縁膜を形成する際には、フォトリソグラフィ法を用いることで必要とするパターン形状を形成している。

しかしながら、これまで露光現像に際し、十分な感度を維持しつつ、ポストベーク後に得られる膜の耐熱性、透明性、密着性を維持することは困難であった。また、一般的にアルカリ可溶性アクリル樹脂を用いた感光性樹脂は透明性が高く高感度であるものの、耐熱性が低く、また、フォトレジストの現像に一般に用いられる、濃度が2.38重量%の水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液を希釈せずに用いた現像は困難であった。

一方で、一般的な熱硬化型感光性アクリル樹脂ではベースとなるポリマーのガラス転移温度が低く、架橋前にリフローがおりパターン形状は半円形のパターンに限定される。また、台形のパターンを得るためには架橋速度をリフロー速度より上げる必要があり、不飽和カルボン酸とエ

ポキシ基含有不飽和化合物を共重合させたポリマーを用いることで熱架橋性を上げるなどして、リフロー前の架橋で台形のパターン形状を得ることができるが、樹脂組成物の保存安定性が悪いなどの問題があった。

本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであって、フォトレジスト工程で一般的に用いられる、濃度が2.38重量%の水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液を用いた現像が可能であり、感度が高く、かつ解像度に優れた感光特性を有し、しかも耐熱性、平坦化性、透明性、低吸水性などの諸特性に優れるポジ型感光性樹脂組成物に関する。さらには、ポストバーク条件により硬化後のパターン形状を半円形または台形の任意の断面を持つパターン形成が可能であるポジ型感光性樹脂組成物およびパターン形成方法を提供することにある。

発明の開示

本発明者は、上記課題を解決するため鋭意検討を行った結果、下記の要旨を有する本発明に到達した。

1. アルカリ可溶性樹脂と、1, 2-キノンジアジド化合物と、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物と、界面活性剤とを含有する組成物であって、上記アルカリ可溶性樹脂が、カルボキシル基含有アクリルモノマーと水酸基含有アクリルモノマーとN-置換マレイミドとを必須成分とした共重合体であることを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。
2. アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、1, 2-キノンジアジドが5～100重量部、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物が1～50重量部、および界面活性剤が0.01～2重量部含有する、1に記載のポジ型感光性樹脂組成物。
3. 上記共重合体の数平均分子量が2,000～9,000である、1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。
4. 上記共重合体を構成するモノマー成分として、カルボキシル基含有

アクリルモノマーを5～30モル%、水酸基含有アクリルモノマーを5～50モル%、及びN-置換マレイミドを10～70モル%含む、1～3のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物。

5. 上記界面活性剤がフッ素系界面活性剤である、1～4のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物。

6. 上記1～5のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物を用い、ポストバーク条件を変えることにより、半円形または台形の任意の断面を持つパターン形状を得ることを特徴とするパターン形成方法。

図面の簡単な説明

第1図は実施例1における断面が半円形のパターンを示す走査型電子顕微鏡写真である。

第2図は実施例2における断面が台形のパターンを示す走査型電子顕微鏡写真である。

発明を実施するための形態

以下、本発明の感光性樹脂組成物について具体的に説明する。

<アルカリ可溶性樹脂>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、カルボキシル基含有アクリルモノマーと水酸基含有アクリルモノマーとN-置換マレイミドとの共重合体（以下、アルカリ可溶性樹脂共重合体ともいう）である。

アルカリ可溶性樹脂共重合体を構成するカルボキシル基含有アクリルモノマーは特に限定されないが、具体例としてはアクリル酸、メタクリル酸などが挙げられる。これらのカルボキシル基含有アクリルモノマーは単独でも2種以上で併用してもよい。

アルカリ可溶性樹脂共重合体におけるカルボキシル基含有アクリルモノマーの比率は、好ましくは5～30モル%、より好ましくは5～25モル%、最も好ましくは5～20モル%である。カルボキシル基含有

アクリルモノマーが5モル%未満の場合には、共重合体のアルカリ溶解性が不足し、30モル%よりも多いと解像度が低下する。また、カルボキシル基含有アクリルモノマーが多い場合には、本発明のポジ型感光性樹脂組成物の保存安定性が悪くなる場合がある。

アルカリ可溶性樹脂共重合体を構成する水酸基含有アクリルモノマーは特に限定されないが、具体例としては2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレートなどが挙げられる。これらの水酸基含有アクリルモノマーは単独でも2種以上で併用してもよい。

アルカリ可溶性樹脂共重合体における水酸基含有アクリルモノマーの比率は、好ましくは5～50モル%、より好ましくは10～40モル%、最も好ましいのは20～30モル%である。水酸基含有アクリルモノマーが5モル%未満の場合には、アルカリ可溶性樹脂共重合体のアルカリ溶解速度が速くなり、十分なプロセスマージンが取れなくなる。また、50モル%よりも多くなると、硬化後の樹脂の吸水率が高くなる。

アルカリ可溶性樹脂共重合体を構成するN-置換マレイミドは特に限定されないが、具体例としてはシクロヘキシルマレイミド、フェニルマレイミド、メチルマレイミド、エチルマレイミドなどが挙げられる。透明性の観点から芳香環を有さない物が好ましく、現像性、透明性、耐熱性の点からシクロヘキシルマレイミドが最も好ましい。

アルカリ可溶性樹脂共重合体におけるN-置換マレイミドの比率は、好ましくは10～70モル%、より好ましくは15～50モル%、最も好ましいのは20～40モル%である。N-置換マレイミドが10モル%未満の場合は、アルカリ可溶性樹脂共重合体のT_gが低くなり、台形のパターンを得ることが困難になり、また得られたパターンの耐熱性が低下し、70モル%よりも多いとパターン形状のコントロールが困難となる。

アルカリ可溶性樹脂共重合体は、カルボキシル基含有アクリルモノマ

一、水酸基含有アクリルモノマー、N-置換マレイミドに、さらに、共重合可能な他のアクリルモノマーなどを含む共重合体であっても良い。これら他のアクリルモノマーとしては、例えばメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、n-ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、2-メトキシエチル（メタ）アクリレート、などの（メタ）アクリル酸エステル類、2,2,2-トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレート、2-（パーフルオロヘキシル）エチル（メタ）アクリレート、などのフッ素含有（メタ）アクリル酸エステル類、（メタ）アクリルアミド、N-（2-ヒドロキシエチル）（メタ）アクリルアミド、などの不飽和アミド類などが挙げられる。これらのうち、共重合体の収率を高める点から、（メタ）アクリル酸エステル類が好ましい。これら他のアクリルモノマーは単独でも2種以上の併用であってもよい。

上記他のアクリルモノマーが含まれる場合、その比率は1～80モル%が好ましく、80モル%よりも多くなると相対的に他の成分が減るため本発明の効果を十分に得ることが困難になる。これら他のアクリルモノマーは、アクリル可溶性樹脂の溶解性、疎水性などの調整、および分子量を制御する目的で導入することができる。

アルカリ可溶性樹脂共重合体を構成する各モノマーの最も好ましい比率の例は、カルボキシル基含有アクリルモノマーが5～20モル%、水酸基含有アクリルモノマーが20～30モル%、N-置換マレイミドが20～40モル%、その他アクリルモノマーが10～55モル%である。

アルカリ可溶性樹脂共重合体を得る方法は特には限定されない。一般的には前記したモノマーを重合溶媒中でラジカル重合することにより製造される。また、必要に応じて、モノマーの官能基を保護した状態でこれらを重合し、その後、脱保護処理を行ってもよい。

アルカリ可溶性樹脂共重合体を製造するために用いられる重合溶媒

としては、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン等の極性溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル等のエステル類、3-メトキシプロピオン酸メチル、2-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、2-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、2-エトキシプロピオン酸エチル等のアルコキシエステル類、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル等の（ジ）グリコールジアルキルエステル類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル等の（ジ）グリコールモノアルキルエーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、カルピトールアセテート、エチルセロソルブアセテート等のグリコールモノアルキルエーテルエステル類、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、2-ヘプタノン等のケトン類を挙げることができる。これらの重合溶媒は単独でまたは2種類以上を組み合わせ用いることができる。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂共重合体の分子量は、ポリスチレン換算数平均分子量で、1,000～200,000、好ましくは2,000～50,000、より好ましくは2,000～9,000のものである。数平均分子量が1,000未満の場合には、得られるパターンの形状が不良なものとなったり、パター

ンの残膜率が低下したり、パターンの耐熱性が低下したりする傾向が見られる。一方、数平均分子量が200,000を超える場合には、感光性樹脂組成物の塗布性が不良なものとなったり、現像性が低下したり、また、得られるパターンの形状が不良なものとなったりする場合がある。また、数平均分子量が9,000を超える場合には、50 μ m以下のパターン間に残膜が存在し解像度が低下する場合がある。よって、微細なパターンを形成させる場合には、数平均分子量を9,000以下とするのが好ましく、8,000以下が特に好ましい。

<1,2-キノンジアジド化合物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される1,2-キノンジアジド化合物としては、水酸基またはアミノ基のどちらか一方か、水酸基およびアミノ基の両方を有する化合物であって、これらの水酸基および/またはアミノ基の好ましくは20~100%、特に好ましくは30~90%が1,2-キノンジアジドスルホン酸でエステル化またはアミド化された化合物を用いることができる。

前記水酸基を有する化合物としては、例えば、フェノール、*o*-クレゾール、*m*-クレゾール、*p*-クレゾール、ヒドロキノン、レゾルシノール、カテコール、4,4-イソプロピリデンジフェノール、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、4,4'-ジヒドロキシフェニルスルホン、4,4-ヘキサフルオロイソプロピリデンジフェノール、4,4',4''-トリヒドロキシトリフェニルメタン、1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、4,4'-[1-[4-[1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェノール、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,2',4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,2',4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン、2,5-ビス(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジルメチル)などのフェノール化合物、エタノール、2-プロパノール、4-

ブタノール、シクロヘキサノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、2-メトキシエタノール、2-ブトキシエタノール、2-メトキシプロパノール、2-ブトキシプロパノール、乳酸エチル、乳酸ブチルなどの脂肪族アルコール類を挙げることができる。

また前記アミノ基を有する化合物としては、アニリン、o-トルイジン、m-トルイジン、p-トルイジン、4-アミノジフェニルメタン、4-アミノジフェニル、o-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテルなどのアニリン類、アミノシクロヘキサンを挙げることができる。

さらに、水酸基とアミノ基の両方を有する化合物としては、例えばo-アミノフェノール、m-アミノフェノール、p-アミノフェノール、4-アミノレゾルシノール、2, 3-ジアミノフェノール、2, 4-ジアミノフェノール、4, 4'-ジアミノ-4''-ヒドロキシトリフェニルメタン、4-アミノ-4', 4''-ジヒドロキシトリフェニルメタン、ビス(4-アミノ-3-カルボキシ-5-ヒドロキシフェニル)エーテル、ビス(4-アミノ-3-カルボキシ-5-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(4-アミノ-3-カルボキシ-5-ヒドロキシフェニル)スルホン、2, 2-ビス(4-アミノ-3-カルボキシ-5-ヒドロキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-アミノ-3-カルボキシ-5-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパンなどのアミノフェノール類、2-アミノエタノール、3-アミノプロパノール、4-アミノシクロヘキサノールなどのアルカノールアミン類を挙げることができる。

これらの、1, 2-キノンジアジド化合物のうち、露光部と未露光部の現像溶解度差のバランスからは、4, 4'-[1-[4-[1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェノールの1, 2-キノンジアジドスルホン酸エステル化物が

好ましい。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物における、1,2-キノンジアジド化合物の含有量は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、好ましくは5～100重量部、より好ましくは10～50重量部、最も好ましいのは10～30重量部である。1,2-キノンジアジド化合物の量が、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して5重量部未満であると、ポジ型感光性樹脂組成物の、露光部と未露光部の現像液溶解度差が小さくなって現像によるパターンニングが困難になることがあり、一方100重量部を超えると、短時間の露光では1,2-キノンジアジド化合物が十分に分解されず、感度が低下してしまうことがある。

<2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物は特に限定されないが、その具体例としては、シクロヘキセンオキサイド構造を有するエポキシ樹脂であるエポリドGT-401、同GT-403、同GT-301、同GT-302、セロキサイド2021、セロキサイド3000（ダイセル化学（株）製）、ビスフェノールA型エポキシ樹脂であるエピコート1001、同1002、同1003、同1004、同1007、同1009、同1010、同828（以上、油化シェルエポキシ（株）製）、ビスフェノールF型エポキシ樹脂であるエピコート807（油化シェルエポキシ（株）製）、フェノールノボラック型エポキシ樹脂であるエピコート152、同154（以上、油化シェルエポキシ（株）製）、EPPN201、同202（以上、日本化薬（株）製）、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂であるEOCN-102、EOCN-103S、EOCN-104S、EOCN-1020、EOCN-1025、EOCN-1027（以上、日本化薬（株）製）、エピコート180S75（油化シェルエポキシ（株）製）、脂環式エポキシ樹脂であるデナコールEX-252（ナガセケムテックス（株）製）、CY175、CY177、CY179（以上、CIBA-GEIGY A.G製）、アラルダイトCY-182、

同CY-192、同CY-184（以上、CIBA-GEIGY A. G 製）、エピクロン200、同400（以上、大日本インキ工業（株）製）、エピコート871、同872（以上、油化シェルエポキシ（株）製）、ED-5661、ED-5662（以上、セラニーズコーティング（株）製）、脂肪族ポリグリシジルエーテルであるデナコールEX-611、同EX-612、同EX-614、同EX-622、同EX-411、同EX-512、同EX-522、同EX-421、同EX-313、同EX-314、同EX-321（ナガセケムテックス（株）製）等を挙げることができる。また、これらの架橋性化合物は、単独または2種類以上を組み合わせる用いることができる。

これらのうち、耐熱性を向上させるという点と架橋温度によりパターン形状をコントロールするという点からシクロヘキセンオキサイド構造を有するエポキシ樹脂が好ましい。

上記2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物の含有量は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して好ましくは1～50重量部、より好ましくは1～20重量部、最も好ましいのは1～10重量部である。エポキシ基含有架橋性化合物の含有量が1重量部未満の場合には、系の架橋密度が不十分となるため、パターン形成後の耐熱性、耐溶剤性が低下し、50重量部を超える場合には、未架橋の架橋性化合物が存在し、パターン形成後の耐熱性、耐溶剤性が低下する。また、エポキシ基含有架橋性化合物の含有量が多いと、感光性樹脂組成物の保存安定性が悪くなる場合がある。

<界面活性剤>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される界面活性剤は、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤などであり、特に限定されないが、塗布性改善効果の高さからフッ素系界面活性剤が好ましい。

フッ素系界面活性剤の具体例としては、エフトツプEF301、EF303、EF352（（株）トーケムプロダクツ製）、メガファックF

171、F173、R-30（大日本インキ（株）製）、フロラードFC430、FC431（住友スリーエム（株）製）、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106（旭硝子（株）製）等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物における界面活性剤の含有量は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、好ましくは0.01～2重量部、より好ましくは0.01～1重量部、最も好ましくは0.01～0.1重量部である。界面活性剤の含有量が2重量部よりも多くなると塗膜がムラになりやすく、0.01重量未満では、塗膜にストリेशन等が発生しやすくなる。尚、2.5 μ m以上の膜厚を得る場合には0.04～1重量部の添加が好ましい。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される各成分の最も好ましい含有量の例は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、1, 2-キノンジアジド化合物が10～30重量部、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物が1～10重量部、界面活性剤が0.01～0.1重量部である。

<その他含有しても良い成分>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、現像後の基板との密着性を向上させる目的で、密着促進剤を含んでいることは勿論好ましい。このような密着促進剤の具体例としては、トリメチルクロロシラン、ジメチルビニルクロロシラン、メチルジフエニルクロロシラン、クロロメチルジメチルクロロシラン等のクロロシラン類、トリメチルメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、メチルジメトキシシラン、ジメチルビニルエトキシシラン、ジフエニルジメトキシシラン、フエニルトリエトキシシラン等のアルコキシシラン類、ヘキサメチルジシラザン、N, N'-ビス（トリメチルシリル）ウレア、ジメチルトリメチルシリルアミン、トリメチルシリルイミダゾール等のシラザン類、ビニルトリクロロシラン、 γ -クロロプロピルトリメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリエ

トキシシラン、 γ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン等のシラン類、ベンゾトリアゾール、ベンズイミダゾール、インダゾール、イミダゾール、2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプトベンゾオキサゾール、ウラゾール、チオウラシル、メルカプトイミダゾール、メルカプトピリミジン等の複素環状化合物や、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア等の尿素、またはチオ尿素化合物を挙げることができる。

これらの密着促進剤の使用割合は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、通常、20重量部以下、好ましくは0.05~10重量部、特に好ましくは1~10重量部である。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、その他、必要に応じて顔料、染料、保存安定剤、消泡剤などを含んでもよい。

<ポジ型感光性樹脂組成物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、上記の各成分を均一に混合することによって容易に調製することができ、通常、適当な溶剤に溶解された溶液状態で用いられる。例えば、アルカリ可溶性樹脂を溶剤に溶解し、この溶液に1, 2-キノンジアジド化合物、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物、界面活性剤および必要に応じて他の成分を所定の割合で混合することにより、溶液として感光性樹脂組成物を調製することができる。そのような溶剤としては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテート、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、エトシキ酢

酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー-3-メチルブタン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、ピルピン酸メチル、ピルピン酸エチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル、乳酸ブチル等を用いることができる。これらの有機溶剤は単独または2種以上の組合せで使用される。

さらに、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート等の高沸点溶剤を混合して使用することができる。これらの溶剤の中でプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、乳酸エチル、乳酸ブチル、及びシクロヘキサノンがレベリング性の向上に対して好ましい。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物を溶液とした時の固形分濃度は、各成分が均一に溶解している限りは、特に限定されない。通常は加工面の容易さから、好ましくは1～50重量%、特に好ましくは20～45重量%の範囲で使用するのが一般的である。溶液の粘度は、好ましくは、5～60 mPa・s、特に好ましくは10～40 mPa・sである。また、上記のように調製されたポジ型感光性樹脂組成物溶液は、孔径が0.5 μm程度のフィルタなどを用いて濾過した後、使用に供することが好ましい。このように調製されたポジ型感光性樹脂組成物の溶液は、室温で長期間の貯蔵安定性にも優れる。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物の溶液は、ガラス基板、シリコンウェハー、酸化膜、窒化膜などの基材上に塗布した後、80～130℃で30秒～600秒予備乾燥して塗膜を形成することができる。

上記の塗膜上に所定のパターンを有するマスクを装着し、光を照射し、アルカリ現像液で現像することにより、露光部が洗い出されて端面のシャープなレリーフパターンが得られる。この際使用される現像液はアルカリ水溶液であればどのようなものでもよく、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属水酸

化物の水溶液、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、コリンなどの水酸化四級アンモニウムの水溶液、エタノールアミン、プロピルアミン、エチレンジアミンなどのアミン水溶液を例として挙げる事ができる。

前記アルカリ現像液は10重量%以下の水溶液であることが一般的で、好ましくは0.5～3.0重量%の水溶液などが用いられる。本発明の感光性樹脂組成物はフォトレジストで一般的に使用される水酸化テトラエチルアンモニウム2.38重量%水溶液で膨潤などの問題なく現像することができる。さらに上記現像液にアルコール類や界面活性剤を添加して使用することもできる。これらはそれぞれ、現像液100重量部に対して、好ましくは0.05～10重量部の範囲で配合する。

現像時間は、通常15～180秒間である。また現像方法は液盛り法、ディッピング法などのいずれでもよい。現像後、流水洗浄を20～90秒間行い、圧縮空気や圧縮窒素で風乾させることによって、基板上の水分を除去し、パターン状塗膜が形成される。その後このパターン状塗膜に、高圧水銀灯などによる光を全面照射し、パターン状塗膜中に残存する1,2-キノンジアジド化合物を完全に分解させる。続いて、ホットプレート、オープンなどにより、ポストバークをすることによって、耐熱性、透明性、平坦化性、低吸水性、耐薬品性に優れ、良好なレリーフパターンを有する塗膜を得ることができる。ポストバークは、例えば温度140～250℃で、ホットプレート上なら5～30分間、オープン中では30～90分間処理すればよい。

＜半円形または台形の任意の断面を持つパターン形状を得る方法＞

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、ポストバーク条件を変えることにより、半円形または台形の任意の断面を持つパターン形状を得ることができる。

半円形の断面を持つパターンを得るためには、比較的高温で加熱する1段階のポストバークをすればよい。その温度としては、170～250℃、好ましくは190～220℃である。

一方、台形の断面を持つパターンを得るためには、まず比較的低温で10～30分加熱し、その後比較的高温で加熱する2段階のポストベークをすればよい。1段階目の温度としては120～160℃、好ましくは130～150℃であり、2段階目の温度としては、170～250℃、好ましくは190～250℃である。

以下に実施例を挙げ、本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

〈実施例1〉

[組成物の各成分]

アルカリ可溶性樹脂：モノマーとしてメタクリル酸13.5モル%、N-シクロヘキシルマレイミド35.3モル%、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.5モル%およびメタクリル酸メチル25.7モル%からなる共重合体（数平均分子量4100（ポリスチレン換算））

1, 2-キノンジアジド化合物：4, 4'-[1-[4-[1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェノール1molと1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロライド2molとの縮合反応によって合成される感光剤（東洋合成工業社製、P-200）

2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物：4官能のシクロヘキセンオキサイド構造を有するGT-401（ダイセル化学工業社製）

界面活性剤：フッ素系であるメガファックR-30（大日本インキ化学社製）

[ポジ型感光性樹脂組成物の調製]

アルカリ可溶性樹脂を22gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート78gに溶解し、これに1, 2-キノンジアジド化合物6.6g、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物1g、界面活性剤0.01g、さらに密着助剤としてγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン1gを添加後、室温で1時間攪拌することにより、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液（1）を調製した。

組成物溶液（１）の粘度は $13.9 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ であり、室温で３ヶ月放置後も粘度の変化は見られなかった。

〔硬化膜の吸水率評価〕

組成物溶液（１）を酸化シリコン付ガラス基板上にスピンコーターを用いて塗布した後、 120°C で９０秒ホットプレート上でプリベークして膜厚 $1.7 \mu\text{m}$ の塗膜を形成した。得られた塗膜全面に 420 nm における光強度が $9 \text{ mW} / \text{cm}^2$ の紫外線を３０秒間（ $270 \text{ mJ} / \text{cm}^2$ ）照射した。紫外線照射後の塗膜を 200°C で１５分間加熱することによりポストベークを行い、膜厚 $1.5 \mu\text{m}$ の硬化膜を形成した。こうして形成された硬化膜を光学顕微鏡により観察したところ、ストリエーション（Striation）の発生等の異常は見られなかった。

この硬化膜を 23°C 湿度 50% 中に２４時間放置した際の吸水率、および２時間煮沸した際の吸水率をマックサイエンス製熱重量分析装置TG-DTAで 120°C まで昇温して測定したところ、 23°C 湿度 50% ２４時間の吸水率は 1.6% 、２時間煮沸の吸水率は 1.7% であった。

〔硬化膜の耐熱性評価〕

前記と同様に作製した硬化膜を基板から削り取りTG-DTA測定により耐熱性の評価をした。その結果、熱分解開始温度は 270°C 、 5% 重量減少温度は 330°C であった。また、ガラス転移温度は 200°C 以上であった。

〔硬化膜の透明性評価〕

酸化シリコン付ガラス基板の代わりに石英基板を用い、前記と同様に硬化膜を得た。この硬化膜を分光光度計を用いて $200 - 800 \text{ nm}$ の波長で測定したところ、 400 nm での透過率は 96% であった。

〔感光特性の評価〕

組成物溶液（１）を酸化シリコン付ガラス基板上にスピンコーターを用いて塗布した後、 120°C で９０秒ホットプレート上でプリベークして膜厚 $1.7 \mu\text{m}$ の塗膜を形成した。この塗膜にテストマスクを通して

紫外線照射装置（キャノン社製、PLA-501）により、420 nmにおける光強度が $9 \text{ mW} / \text{cm}^2$ の紫外線を10秒間（ $90 \text{ mJ} / \text{cm}^2$ ）照射した。次いで、23℃の2.38% TMAH水溶液（東京応化社製、NMD-3）に45秒間浸漬して、現像を行った後、超純水で20秒間の流水洗浄を行いポジ型のパターンを形成させた。

現像後の未露光部の膜厚は約 $1.7 \mu\text{m}$ で膜減りは全く見られなかった。パターン解像度は、ライン/スペースで $3 \mu\text{m}$ までパターン剥離なく形成された。その後、全面に420 nmにおける光強度が $9 \text{ mW} / \text{cm}^2$ の紫外線を30秒間（ $270 \text{ mJ} / \text{cm}^2$ ）照射し、200℃で15分間のポストベークを行い、膜厚 $1.5 \mu\text{m}$ のパターンが得られた。このパターンの断面形状を走査型電子顕微鏡を用いて評価したところ、図1に示すような半円形のパターンであった。

〔感度の評価〕

上記のパターン形成において、現像前の紫外線の照射量を $10 \text{ mJ} / \text{cm}^2$ ずつ変えて紫外線照射処理を行い、露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定したところ、 $50 \text{ mJ} / \text{cm}^2$ の照射で完全に溶解した。

〈実施例2〉

実施例1の感光特性評価において、200℃で15分間の1段階ポストベークに変えて、140℃15分ホットプレートで加熱した後、200℃で15分間加熱する2段階ポストベークを行った。その結果、得られたパターンの断面形状は図2に示すような台形のパターンであった。

〈実施例3〉

アルカリ可溶性樹脂として、メタクリル酸9モル%、N-シクロヘキシルマレイミド32.8モル%、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.4モル%およびメタクリル酸メチル32.8モル%からなる共重合体（数平均分子量3900（ポリスチレン換算））を用いたこと以外は実施例1と同様に調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液（2）を得た。組成物溶液（2）の粘度は $13.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ であり、

室温で3ヶ月放置後も粘度の変化は見られなかった。

この組成物溶液(2)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。その結果、硬化膜にストリエーションの発生等の異常は見られず、400nmでの透過率は96%、5%重量減少温度は330℃であり、ガラス転移温度は200℃以上であった。

また、感光特性の評価では、現像後の未露光部の膜減りは全く見られず、パターン解像度は、ライン/スペースで3μmまでパターン剥離なく形成され、パターン断面の形状は半円形であった。感度は50mJ/cm²であった。

〈実施例4〉

溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのかわりにシクロヘキサノンを用いたこと以外は実施例1と同様にして本発明のポジ型感光性組成物である組成物溶液(3)を得た。組成物溶液(3)の粘度は13.9mPa・sであり、室温で3ヶ月放置後も粘度の変化は見られなかった。

この組成物溶液(3)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。その結果、硬化膜にストリエーションの発生等の異常は見られず、400nmでの透過率は96%、5%重量減少温度は330℃であり、ガラス転移温度は200℃以上であった。

また、感光特性の評価では、現像後の未露光部の膜減りは全く見られず、パターン解像度は、ライン/スペースで3μmまでパターン剥離なく形成され、パターン断面の形状は半円形であった。感度は50mJ/cm²であった。

〈比較例1〉

アルカリ可溶性樹脂として、メタクリル酸13.5モル%、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.5モル%およびメタクリル酸メチル61モル%からなる共重合体(数平均分子量4100(ポリスチレン換算))を用いたこと以外は実施例1と同様に調製し、組成物溶液(4)を得た。

この組成物溶液（４）を用いて、実施例１と同様に評価を行った。その結果、硬化膜にストリエーションの発生等の異常は見られず、４００ nmでの透過率は９６％であったが、５％重量減少温度は２９０℃であり、耐熱性に劣るものであった。

また、感光特性の評価では、現像後の未露光部の膜減りは全く見られず、パターン解像度は、ライン／スペースで３μmまでパターン剥離なく形成され、パターン断面の形状は半円形であった。感度は５０mJ/cm²であった。

〈比較例２〉

比較例１において、実施例２と同様に２００℃で１５分間の１段階ポストバークに変えて、１４０℃１５分ホットプレートで加熱した後、２００℃で１５分間加熱する２段階ポストバークを行ったが、得られたパターンの断面形状は半円形であり、図２に示すような台形のパターンは得られなかった。

〈実施例５〉

実施例１においてアルカリ可溶性樹脂の数平均分子量が１０，０００のものを使用した以外は実施例１と同様に調製し、組成物溶液（５）を得た。

この組成物溶液（５）を用いて、実施例１と同様に評価を行った。その結果、硬化膜にストリエーションの発生等の異常は見られず、４００ nmでの透過率は９６％、５％重量減少温度は３３０℃であり、ガラス転移温度は２００℃以上であった。

また、感光特性の評価では、現像後の未露光部の膜減りは全く見られなかったが、ライン／スペースで５０μm以下のパターン間に現像後残膜があり、現像時間を延ばしてもこの現象は解消されなかった。パターン断面の形状は半円形であった。

〈比較例３〉

実施例１において界面活性剤を添加せずに、組成物溶液（６）を得た。この組成物溶液（６）を用いて、実施例１と同様に評価を行った。そ

の結果、硬化膜にストリエーションが発生し、正常な膜が得られなかった。

産業上の利用可能性

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、高感度、高解像度のポジ型感光特性を有し、しかもアルカリ水溶液によるエッチングが容易であり、所定パターンを有するマスクを用いて露光することにより、微細形状かつ寸法精度の高いレリーフパターンを有する塗膜を容易に得ることができる。

また、本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、高感度であり、かつ、一般的に使用される、濃度 2.38 重量%の水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液を用いて現像可能で、しかもポストバーク条件により半円形または台形の断面を持つ任意のパターン形状を形成することができる。さらにパターン形成後の硬化処理により透明性、耐熱性、平坦化性、低吸水性などの特性に優れたパターンを容易に形成することができる。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、LCDに用いられる TFT の層間絶縁膜、カラーフィルターの保護、平坦化膜、反射型ディスプレイの反射板として用いられる Al 膜下の凹凸膜、マイクロレンズ材料、有機 EL 素子の絶縁膜等を形成する材料として好適である。

請求の範囲

1. アルカリ可溶性樹脂と、1, 2-キノンジアジド化合物と、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物と、界面活性剤とを含有する組成物であって、上記アルカリ可溶性樹脂が、カルボキシル基含有アクリルモノマーと水酸基含有アクリルモノマーとN-置換マレイミドとを必須成分とする共重合体であることを特徴とする、ポジ型感光性樹脂組成物。
2. アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、1, 2-キノンジアジドが5～100重量部、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物が1～50重量部、および界面活性剤が0.01～2重量部含有する請求項1に記載のポジ型感光性樹脂組成物。
3. 上記共重合体の数平均分子量が2,000～9,000である請求項1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。
4. 上記共重合体が、カルボキシル基含有アクリルモノマーを5～30モル%、水酸基含有アクリルモノマーを5～50モル%、及びN-置換マレイミドを10～70モル%含む請求項1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。
5. 上記界面活性剤がフッ素系界面活性剤である、請求項1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。
6. 請求項1～5のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物を用い、ポストバーク条件を変えることにより、半円形または台形の任意の断面を持つパターン形状を得ることを特徴とするパターン形成方法。

1 / 1

図 1

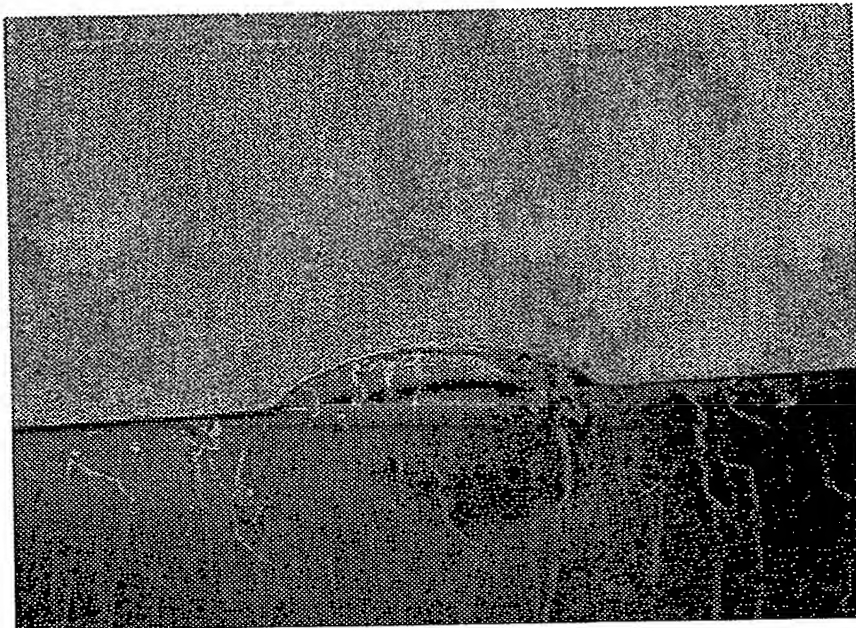
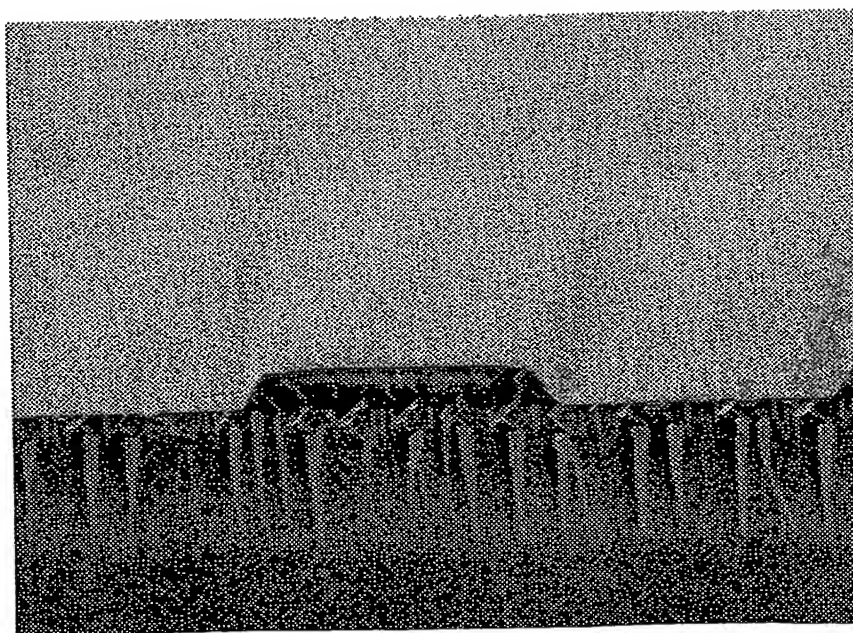


図 2



差替え用紙 (規則26)

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/04954

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G03F7/039, G03F7/022, G03F7/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G03F7/039, G03F7/022, G03F7/40

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	EP 1188580 A2 (FUJI PHOTO FILM CO., LTD.), 20 March, 2002 (20.03.02), Full text; all drawings & JP 2002-103841 A	1-5 6
X Y	JP 2002-23363 A (Dainippon Ink And Chemicals, Inc.), 23 January, 2002 (23.01.02), Claims; Par. Nos. [0040] to [0046], [0054] to [0057], [0088] (Family: none)	1-4 5, 6
Y	EP 1074887 A1 (Kodak Polychrome Graphics GmbH), 07 February, 2001 (07.02.01), Full text & JP 2001-109148 A	1-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
03 July, 2003 (03.07.03)

Date of mailing of the international search report
15 July, 2003 (15.07.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/04954

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 1-307228 A (Hitachi, Ltd.), 12 December, 1989 (12.12.89), Full text; all drawings (Family: none)	6 1-5
Y A	JP 8-29608 A (Sharp Corp.), 02 February, 1996 (02.02.96), Full text; all drawings (Family: none)	6 1-5
P, X P, A	JP 2002-287351 A (JSR Corp.), 03 October, 2002 (03.10.02), Claims; Par. Nos. [0009] to [0017], [0039] to [0041] (Family: none)	1-5 6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G03F7/039, G03F7/022, G03F7/40

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G03F7/039, G03F7/022, G03F7/40

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2003年
日本国実用新案登録公報	1996-2003年
日本国登録実用新案公報	1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	EP 1188580 A2 (FUJI PHOTO FILM CO., LTD.) 2002.03.20, 全文, 全図 & JP 2002-103 841 A	1-5 6
X Y	JP 2002-23363 A (大日本インキ化学工業株式会 社), 2002.01.23, 【特許請求の範囲】 【0040】- 【0046】 【0054】-【0057】 【0088】 (ファミリ ーなし)	1-4 5, 6

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.07.03

国際調査報告の発送日

15.07.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

前田 佳与子



2H

9019

電話番号 03-3581-1101 内線 3231

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	EP 1 0 7 4 8 8 7 A 1 (Kodak Polychrome Graphics GmbH) 2001. 02. 07, 全文 & JP 2001-109148 A	1-6
Y	JP 1-307228 A (株式会社日立製作所)	6
A	1989. 12. 12, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-5
Y	JP 8-29608 A (シャープ株式会社)	6
A	1996. 02. 02, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-5
PX	JP 2002-287351 A (ジェイエスアール株式会社)	1-5
PA	2002. 10. 03, 【特許請求の範囲】 【0009】 - 【0017】 【0039】 - 【0041】 (ファミリーなし)	6